



AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA “FORNITURA DI SORGENTE DI GAS ELIO 6.0 PER CAMERA AL PLASMA”

L'Istituto Nazionale di Astrofisica e Planetologia Spaziali, (di seguito INAF-IAPS) intende con il presente avviso, espletare un'indagine di mercato avente ad oggetto l'affidamento della “Produzione e fornitura di un emettitore di gas elio 6,0” da utilizzare in una “camera al plasma” sita nei laboratori del nostro istituto.

In considerazione della mancanza del bene oggetto della gara nelle categorie merceologiche vendibili nel MEPA questa amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte di Operatori economici, a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto avviata con Determina n. 105 del 11/11/2016

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Trattasi di una indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento in ottemperanza del combinato disposto del comma 7 dell'art. 36 e del comma 9 dell'art. 216, e dell'art. 66 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

L'INAF-IAPS si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare (in tutto o in parte), il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento della fornitura di cui sopra, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

Si richiede pertanto agli Operatori economici interessati a manifestare l'interesse ed a essere invitati alla successiva procedura di affidamento di possedere i requisiti generali, economico-finanziari e tecnici:

Possono partecipare alla presente procedura di affidamento gli Operatori Economici indicati negli articoli 3 comma 1 lettera p) e 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- 2- requisiti relativi ai criteri di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
 - a) idoneità professionale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente al presente procedura
 - b) capacità economica e finanziaria: art. 83 comma 4 lettera a), possedere un fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto;
 - c) capacità tecnica: art. 83 comma 6, aver effettuato negli ultimi tre anni, con committenti pubblici o privati forniture analoghe;

3- inesistenza di ulteriori impedimenti alla partecipazione alla gara (art. 32-quater del codice penale) o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici.



Elementi essenziali dell'appalto

Fornitura di sorgente di Elio, con le caratteristiche prescritte riportate alla fine del presente avviso reperibile sul profilo di committente <http://www.iaps.inaf.it/> sezione "Amministrazione Trasparente", "Avvisi di manifestazione di interesse". Prescrizioni contrattuali di dettaglio saranno indicate nell'eventuale lettera d'invito.

Importo stimato per la fornitura

L'amministrazione stima in euro 28.000,00 (ventottomila), oltre l'IVA di legge, l'importo netto massimo, che verrà posto al ribasso, per la fornitura dei prodotti sopra elencati;

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Nel modulo disponibile per il download sul profilo di committente <http://www.iaps.inaf.it/> sezione "Amministrazione Trasparente", "Avvisi di manifestazione di interesse", l'Amministrazione fornisce il facsimile da utilizzarsi come Istanza di partecipazione e dichiarazione, da sottoscrivere in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente i requisiti di ordine generale, professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità Tecnica di cui il fornitore dispone per eseguire l'appalto.

Gli Operatori Economici che intendano candidarsi per essere invitati dovranno far pervenire il suddetto modulo debitamente compilato, sottoscritto dal rappresentante legale e corredato di documento d'identità del sottoscrittore, all'INAF - IAPS in forma di allegato di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo inafiaps@pcert.postecert.it entro le ore 10:00 del giorno 28 ottobre 2016. In alternativa la manifestazione di interesse potrà essere consegnata, entro il termine suddetto, all'Ufficio Acquisti dell'INAF IAPS sito in via del Fosso del Cavaliere, 100 – 00133 Roma a mezzo di Raccomandata R/R oppure tramite corriere oppure mediante consegna a mano.

La PEC (o l'eventuale busta oltre al mittente) dovrà riportare la seguente dicitura/oggetto: "Indagine di mercato – Fornitura sorgente di Elio per Camera al Plasma".

Ai fini del rispetto del termine faranno fede solo ed esclusivamente la data e l'ora di consegna alla casella PEC dell'Ente ovvero la data e l'ora di consegna indicata nella ricevuta rilasciata dall'ufficio Acquisti.

Procedura e criterio di aggiudicazione

In esito alla ricezione delle manifestazioni d'interesse, l'Amministrazione procederà all'affidamento diretto al miglior offerente ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, previo esperimento di gara informale con gli operatori economici selezionati.

L'esame delle offerte sarà effettuata in aderenza con le disposizioni del vigente D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà formulato l'offerta più bassa secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del succitato Decreto Legislativo.

Trattamento dei dati personali



Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento.

Responsabile unico del procedimento Dr. Emanuele Quintorio

Il Responsabile della corretta esecuzione del contratto: Dr. Piero Diego

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli Operatori Economici interessati, dovranno avvenire mediante posta elettronica, presso i punti di contatto come sotto specificati:

- Quesiti tecnici: Responsabile esecuzione contratto Dr. Piero Diego piero.diego@iaps.inaf.it
- Quesiti amministrativi: R.U.P., Emanuele Quintorio emanuele.quintorio@iaps.inaf.it

Le risposte saranno pubblicate nel profilo del Committente (<http://www.iaps.inaf.it/> sezione "Amministrazione Trasparente", "Avvisi di manifestazione di interesse")

SPECIFICHE TECNICHE

Per effettuare simulazioni e test in ambiente spaziale realistico è necessario generare un plasma con le caratteristiche tipiche delle regioni in cui voleranno i payload.

La camera a plasma dell'IAPS/INAF, già dotata di sorgente di plasma per simulare le orbite ionosferiche, potrebbe estendere le tipologie di test anche a missioni che volano fuori della magnetosfera.

A tale scopo si rende necessario l'acquisto di una sorgente con le seguenti caratteristiche:

- Gas utilizzato Elio 6.0
- Flangia di accoppiamento Sorgente/Camera: tipo ISO 250 F
- Energia del flusso di plasma (ioni) emesso: regolabile fino a 2kV
- Angolo di diffusione del fascio di plasma: 10° a 2 keV, circa 20° a 1 keV, e >30° a 500 eV
- Distribuzione della densità del fascio: Gaussiana con FWHM ai suddetti valori di divergenza del fascio
- Griglia di accelerazione degli ioni con passo dimensionato per lavorare con flussi di gas inferiori a 1 sccm
- Griglie addizionali, da sostituire, per lavorare a maggiori valori di flusso di gas (fino a 10 sccm)
- Range di corrente ionica emessa: da 5 micro Ampere a 10 milli Ampere
- Griglia di soppressione degli elettroni primari con energie fino 10 eV
- Filamento termoionico per il rilascio di elettroni secondari per neutralizzare il fascio di ioni

Helium source specification

- gas to be injected helium 6.0
- installation flange ISO250F
- ion energy of plasma beam up to 2 keV
- plasma beam angle of diffusion about 10° at 2 keV, about 20° at 1 keV, and >30° at 500 eV
- Gaussian density distribution with a half-width derived from the divergence angle above



- accelerating grid able to work with gas flow < 0.1 sccm
- additional accelerating grids to be easily replaced to work with larger gas flows
- ion current range from 5 micro Ampere to 5 milli Ampere
- primary hot (up to 10 eV) electron suppression grids
- thermionic filament outside the source for plasma neutralization.

Il Responsabile del Procedimento

Roma, 11/11/2016